# (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-194615

(43)公開日 平成6年(1994)7月15日

(51) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G02F 1/13

101 505 9315-2K

1/1339

8507-2K

1/1341

8507-2K

審査請求 未請求 請求項の数1

(全5頁)

(21)出願番号

特願平4-343716

(22)出願日

平成 4 年(1992)12月24日

(71)出願人 000001443

FΙ

カシオ計算機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

(72) 発明者 坂本 克仁

東京都八王子市石川町2951番地の5 カシ

才計算機株式会社八王子研究所内

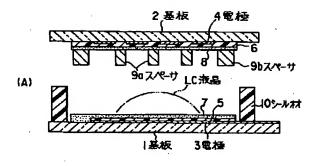
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

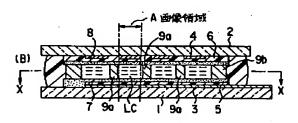
## (54) 【発明の名称】強誘電性液晶素子の製造方法

## (57)【要約】

【目的】 基板間の隙間を一定に保つスペーサを画素領域から外れる部分に配置させて表示品位の低下を防止できるとともに、その隙間内に封入する強誘電性液晶と未硬化状態のシール材との接触を避けてそのシール材による液晶への悪影響を防止することができる強誘電性液晶素子の製造方法を提供する。

【構成】 透明電極3,4が形成された一対の基板1,2間に強誘電性液晶LCを封入してなる強誘電性液晶素子を製造する方法であって、基板2にその画素領域Aを避ける部分に配置する柱状のスペーサ9aと、基板2の周縁に沿う部分に配置する枠状のスペーサ9bとをフォトリソグラフィー法により同時に形成し、かつ基板1に枠状のシール材10を形成し、基板1の上に強誘電性液晶を滴下し、ついで両基板1,2をシール材10が枠状のスペーサ9bの外周に配置するように重ね合わせて加圧し、この状態でシール材10を硬化させ、このシール材10を介して両基板1,2を接着させる。





20

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】透明電極が形成された一対の基板間に強誘 電性液晶を封入してなる強誘電性液晶素子を製造する方 法であって、

前記一対の基板のいずれか一方に、その画素領域を避け る部分に配置する柱状のスペーサと、該基板の周縁に沿 う部分に配置する枠状のスペーサとをフォトリソグラフ ィー法により同時に形成し、かつ前記一対の基板の少な くとも一方に、前記枠状のスペーサの外周を囲むことが 可能な大きさの枠状のシール材を形成し、前記いずれか 10 一方の基板の上に強誘電性液晶を滴下し、ついで前記一 対の基板を前記シール材が前記枠状のスペーサの外周に 配置するように重ね合わせて加圧し、この状態で前記シ ール材を硬化させ、このシール材を介して両基板を接着 させることを特徴とする強誘電性液晶素子の製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、透明電極が形成された 一対の基板間に強誘電性液晶を封入してなる強誘電性液 晶素子の製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】強誘電性液晶素子は、透明電極が形成さ れた一対の基板間に強誘電性液晶を封入してなるもの で、その基板間に封入する強誘電性液晶としては、二つ の方向の配向のメモリ性(配向状態の安定性)をもつ通 常の強誘電性液晶と、三つの方向の配向のメモリ性をも つ反強誘電性と呼ばれる強誘電性液晶が用いられてい

【0003】このような強誘電性液晶は、いずれもネマ ティク液晶に比べてその粘度が高く、このため基板間の 30 隙間内へ注入する際に、通常の真空注入法により注入す ることがほとんど困難である。

【0004】このため、強誘電性液晶においては、図3 に示す方法により基板間への封入が行われている。すな わち、液晶素子を構成する一対の基板a,bの一方、ま たは両方に液晶封入領域を囲む枠状のシール材 cを形成 し、一方の基板 a の上に強誘電性液晶 L C を滴下し、つ いで両基板 a. bを一定の圧力を加えながら重ね合わ せ、前記シール材 c により両基板 a , b を互いに接着さ せる。なお、液晶LCの滴下ならびに両基板 a, b の接 40 着は、図示しない真空槽内で行われる。

【0005】このような方法によれば、基板 a の上に滴 下された粘度の高い液晶LCが両基板a,bの重ね合わ せ時の圧力でシール材 c で囲まれた液晶封入領域内に均 等に流れ拡がって封入される。

【0006】ところで通常の液晶素子においては、基板 間に球状のガラス粒や短く切断したグラスファイバ等か らなる多数のスペーサが散布され、これらスペーサによ り基板間の隙間のギャップが一定に保持される。

間に液晶を封入して液晶素子を製造する場合において は、予め基板の上に多数のスペーサを一様な分布状態に 散布しておいても、液晶が基板の上で流れ拡がるときに そのスペーサが移動して均等的な分布が崩れてしまう。

【0008】また、強誘電性液晶はもともと配向しにく い性質をもつが、とくにその液晶中にスペーサが介在し ていると、そのスペーサの付近で配向が大きく乱れる。 したがってスペーサが一方の基板に形成された電極と、 他方の基板に形成された電極との対向間つまり画素領域 内に介在していると、その配向の乱れにより画像表示時 に表示むらが生じて表示品位が低下し、このためスペー サは画素領域から外れる位置に配置させることが好まし

【0009】ところが、上述のようにスペーサを基板の 上に散布して設ける手段では、その位置が無秩序とな り、したがって画素領域を避けるように配設することが 困難となる。

【0010】そこで、例えば、一方の基板の周縁部にシ ール材を印刷により枠状に形成し、他方の基板の上に、 画素領域を避けるように、フォトリソグラフィー法によ り多数のスペーサを均等的に形成し、かつ一方の基板の 上に強誘電性液晶を滴下し、ついで両基板を一定の圧力 で重ね合わせ、前記スペーサによりその両基板間のギャ ップを一定に保ち、この状態でシール材を加熱して硬化 させ、このシール材により両基板を接着して液晶素子を 組み立てる製造方法が一般に採用されている。

【0011】このような製造方法によれば、スペーサが 基板に対して一体的に形成されているから、強誘電性液 晶の拡がり時の流れで移動するようなことがなく、また 各スペーサが画素領域を避ける部分に配置するから、画 像を表示したときに表示むらが生じるようなことがな ٧ V

#### [0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな製造方法においては、両基板を重ね合わせてその隙 間内に強誘電性液晶を封入し、こののちシール材を加熱 して硬化させるものであるから、強誘電性液晶が未硬化 状態のシール材と直接接触してしまう。

【0013】強誘電性液晶とシール材が直接接触する と、シール材中の不純物が液晶中に混入して液晶の特性 が悪化してしまう恐れがある。そしてこののちシール材 が加熱されて硬化する際に、このシール材から揮発性物 質等が発生してこれが液晶中に混入し、さらに大きな悪 影響が生じてしまう。

【0014】本発明はこのような点に着目してなされた もので、その目的とするところは、基板間の隙間を一定 に保つスペーサを画素領域から外れる部分に配置させて 表示品位の低下を防止できるとともに、その隙間内に封 入する強誘電性液晶と未硬化状態のシール材との接触を 【0007】しかしながら、上述したような方法で基板 50 避けてそのシール材による液晶への悪影響を防止するこ

とができる強誘電性液晶素子の製造方法を提供すること にある。

### [0015]

【課題を解決するための手段】本発明はこのような目的を達成するために、透明電極が形成された一対の基板間に強誘電性液晶を封入してなる強誘電性液晶素子を製造する方法であって、前記一対の基板のいずれか一方に、その画素領域を避ける部分に配置する柱状のスペーサと、該基板の周縁に沿う部分に配置する枠状のスペーサとをフォトリソグラフィー法により同時に形成し、かつ10前記一対の基板の少なくとも一方に、前記枠状のスペーサの外周を囲むことが可能な大きさの枠状のシール材を形成し、前記いずれか一方の基板の上に強誘電性液晶を滴下し、ついで前記一対の基板を前記シール材が前記枠状のスペーサの外周に配置するように重ね合わせて加圧し、この状態で前記シール材を硬化させ、このシール材を介して両基板を接着させるようにしたものである。

### [0016]

【作用】両基板を重ね合わせて加圧したときに、基板上の強誘電性液晶が流れ拡がる。しかしスペーサが基板に 20 フォトリソグラフィー法により一体的に設けられているから、強誘電性液晶の流れ拡がりの圧力でスペーサが移動するようなことがなく、したがって両基板間の隙間が一定に保たれる。そして柱状のスペースが画素領域を避ける部分に配置しているから、画像表示時に表示むらが生じるようなことがない。

【0017】基板の上に強誘電性液晶を滴下して両基板を重ね合わせた際には、枠状のスペーサがシール材の内側に嵌合し、このためその重ね合わせに応じて流れ拡がる強誘電性液晶は枠状のスペーサにより遮られて未硬化 30状態のシール材と接触するようなことがない。したがって未硬化状態のシール材中の不純物等が強誘電性液晶中に混入したり、シール材を加熱して硬化させる際にそのシール材から発生する揮発性物質等が強誘電性液晶中に混入するようなことがない。

## [0018]

【実施例】以下、本発明の一実施例について図1および 図2を参照して説明する。

【0019】図1(A)は、基板1,2間に強誘電性液晶LCを封入する前の状態を示し、図1(B)は基板1,2間の隙間内に強誘電性液晶LCを封入して液晶素子を組み立てた状態を示してある。

【0020】各基板1,2にはそれぞれその一方の面の上に透明な電極3,4が配列形成されている。これら電極3,4は、両基板1,2を重ね合わせときに立体的に交差するように配置し、その交差の対向間が画素領域Aとなるものである。電極3,4はそれぞれ絶縁膜5,6で覆われ、この絶縁膜5,6の上に配向膜7,8が形成されている。

【0021】基板2における配向膜8の上には、多数の 50 を保持したまま、シール材10を加熱して硬化させ、こ

柱状のスペーサ9 a と枠状のスペーサ9 b が形成されている。これら柱状のスペーサ9 a および枠状のスペーサ9 b はそれぞれ一定の高さに形成され、一方の柱状のスペーサ9 a は、図2に示すように、画素領域Aとなる部分を避け、かつ基板2の上に均等的に分布するように配置し、他方の枠状のスペーサ9 b は基板2の周縁のやや内側の部分に沿って前記柱状のスペーサ9 a を囲むように配置している。

【0022】このようなスペーサ9a,9bは、基板2の上の全体に例えば感光性樹脂を一定の厚さに塗布し、これをフォトリソグラフィー法によりパターニングする方法で形成する。したがって各スペーサ9a,9bの高さが確実に均一の寸法に仕上がる。

【0023】なお、スペーサ9a,9bを形成する工程と、絶縁膜6および配向膜8を形成する工程は逆の順序であってもよい。すなわち、基板2の上に電極4を形成したのちに、この基板2の上に感光性樹脂を塗布し、これをフォトリソグラフィー法によりパターニングして前記電極4を避ける部分に柱状のスペーサ9aを、基板2の周縁部分に枠状のスペーサ9bを形成し、ついで基板2の上に前記電極4を覆う絶縁膜5を形成し、この絶縁膜5の上に配向材を塗布しその膜面にラビング等による配向処理を施して配向膜8を形成するようにしてもよい。

【0024】一方、基板1の上には、前記枠状のスペーサ9bの外周を囲むことが可能な拡がりの大きさをもつ枠状のシール材10が形成されている。このシール材10は例えば熱硬化性樹脂からなり、印刷法により基板1の上に形成されている。次に、液晶素子を組み立てる工程について説明する。

【0025】まず、図1(A)に鎖線で示すように、一方の基板1の上の中央部分に強誘電性液晶LCをその封入量に見合う量だけ滴下して乗せ、この基板1の上方に他方の基板2を対向して配置させる。このとき、両基板1,2は強誘電性液晶LCが液晶相から液体相に転位する付近の温度にまで予め加熱しておく。

【0026】ついで、一方の基板1のシール材10が他方の基板2の枠状のスペーサ9bの外周に嵌合するように両基板1,2を一定の圧力を加えながら重ね合わせる。この重ね合わせにより両基板1,2間の強誘電性液晶LCが液晶封入領域の全体に流れ拡がり、かつ両基板1,2間の隙間が柱状のスペーサ9bにより一定に保持される。

【0027】また両基板1,2の重ね合わせに応じて、基板1に形成されたシール材10が基板2に圧着するとともに、その圧力でシール材10が図1(B)に示すように弾性的に変形して枠状のスペーサ9bの外周部に密着する。

【0028】こののち、基板1,2の重ね合わせの圧力を保持したまま、シール材10を加熱して硬化させ、こ

のシール材10により両基板1,2を接着して液晶素子を組み立てる。なお、このような液晶素子の組み立ての工程は、真空槽内において行なう。

【0029】このような製造方法においては、スペーサ9a,9bが基板2に一体的に形成されているから、強誘電性液晶しCが流れ拡がるときの圧力で移動するようなことがなく、したがって柱状のスペーサ9aが両基板1,2間に均等的に分布して確実に両基板1,2間の隙間が一定に保たれる。そして前記柱状のスペース9aが画素領域Aを避ける部分に配置しているから、画像表示10時に表示むらが生じるようなことがなく、表示品位の低下を防止することができる。

【0030】基板1の上に強誘電性液晶LCを滴下して 両基板1,2を重ね合わせた際には、枠状のスペーサ9 bがシール材10の内側に嵌合し、このためその重ね合 わせに応じて流れ拡がる強誘電性液晶LCは前記枠状の スペーサ9bにより遮られて強誘電液晶LCと未硬化状 態のシール材10とが直接接触するようなことがない。

【0031】したがって未硬化状態のシール材10中の不純物等が強誘電性液晶LC中に混入することも、また 20シール材10を加熱して硬化させる際にこのシール材10から発生する揮発性物質等が強誘電性液晶LC中に混入するようなことがなく、シール材10による液晶LCへの悪影響を確実に防止することができる。

【0032】なお、前記実施例においては、一方の基板 1にシール材10を形成し、他方の基板2にスペーサ9 a,9bを形成するようにしたが、いずれか一方の基板 1または2にシール材10とスペーサ9a,9bを形成 して両基板1,2を重ね合わせるような場合であっても よいし、また両方の基板 1, 2 にシール材 1 0 を形成 し、両基板 1, 2 を重ね合わせる際にそのシール材 1 0 を互いに圧着させるような場合であっても差し支えな い。

#### [0033]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、基板間の隙間を一定に保つスペーサを画素領域から外れる部分に配置させることができ、したがって表示品位の低下を防止でき、また両基板を重ね合わせてその隙間内に強誘電性液晶を封入する際に、その強誘電性液晶と未硬化状態のシール材との接触を避けることができ、したがってそのシール材から液晶へ不純物等が混入するような悪影響を防止することができる利点がある。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例による強誘電性液晶素子を製造する方法を説明するための図で、(A)は一対の基板を重ね合わせる前の状態を示す断面図、(B)は一対の基板を重ね合わせた後の状態を示す断面図である。

【図2】図1 (A) のX-X線に沿う断面図である。

【図3】基板間に強誘電性液晶を封入する一般的な方法 を説明するための斜視図である。

## 【符号の説明】

1. 2…基板

3, 4…電極

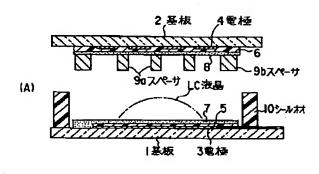
9 a , 9 b …スペーサ

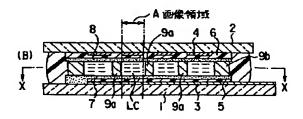
10…シール材

LC…強誘電性液晶

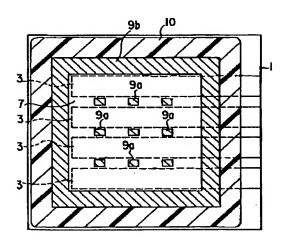
A…画素領域

【図1】





【図2】



|  | • . | . , |   | • | P |
|--|-----|-----|---|---|---|
|  |     |     |   |   |   |
|  |     |     |   |   |   |
|  |     |     |   |   |   |
|  |     |     |   |   |   |
|  |     |     | , |   |   |
|  |     |     |   |   |   |
|  |     |     |   |   |   |
|  | i.  |     |   |   |   |